No	△米〒1	装置	v- +	Make:	如戶	内给	装置設置
140	分類1 分類2	装置名	メーカー型名	Maker type	部屋	内線 -ル	場所
	クリーン			.ypc	-		
	ルーム内	マスクアライナー	ミカサ	Mikasa			創成科学
28	設置装置						研究棟
		Mask Aligner	MA-20	MA-20	nano-	المامين المعالم	
	クリーン				support@e	s.nokudai	
	ルーム内	真空蒸着装置	サンバッ	SANVAC			
29	設置装置		ク				創成科学
29		Vacuum Evaporation	ED-	ED-	nano-		研究棟
		Chamber	1500R	1500R	support@e	s.hokudai	
		onambor .	100011	100011	.ac.jp		
	クリーン ルーム内	反応性イオンエッチング装	サムコ	SAMCO			
	設置装置	置	9 Д 🗆	SAIVICO			
30	DX = 2X =						創成科学
		Reactive Ion Etching	RIE-	RIE-	nano- support@e	a bakudai	研究棟
		System	10NRV	10NRV	.ac.jp	S.HOKUUAI	
					.uc.jp		
	クリーン	ICP高密度プラズマエッチン	サムコ	SAMCO			
	ルーム内 設置装置	グ装置	サムコ	SAIVICO			
	双胆衣胆						
							VII
31					nano-		創成科学 研究棟
		Inductively Coupled Plasma		RIE-	support@e	s.hokudai	リリブリホ
		high-density etching facility	101iHS	101iHS	.ac.jp	omonadar	
	クリーン						
32	ルーム内	プラズマCVD装置	サムコ	Samco			
	設置装置						創成科学
		Plasma-enhanced chemical	PD-	PD-	nano-		研究棟
-32		vapor deposition system	220ESN	220ESN	support@e	s.hokudai	
	クリーン			Sumitom	.ac.jp		
33	ルーム内	ICPドライエッチング装置	住友精密	o Sumitom			
55	設置装置	101 1 7 1 二 7 7 7 7 校直	工業	Precision			
	DC 2C						
							創成科学
		Inductively Coupled Plasma	SPM-200 SP		nano- support@es.hokudai		研究棟
-33		dry-etching facility					
					.ac.jp		
	クリーン						
	ルーム内	液体ソースプラズマCVD装 置	サムコ	SAMCO			
	設置装置	ie.					
24							創成科学
34		Plasma-enhanced liquid			nano-		研究棟
		source chemical vapor	PD-10C1	PD-10C1	support@e	s.hokudai	
		deposition system			.ac.jp		
	クリーン	ヘリコンスパッタリング装	アルバッ	111.1/4.0			
	ルーム内 設置装置	置	2	ULVAC			
	以四次但						
25							創成科学
35			MPS-	MPS-	nano-		研究棟
		Helicon sputtering system	4000C1/	4000C1/	support@e	s.hokudai	
			HC1	HC1	.ac.jp		
	クリーン						
	ルーム内	電子線照射装置	日立	Hitachi	02-304	9338	
36	設置装置						創成科学
		Electron Beam Lithography	S-4200特	S-	k-		研究棟
		System	SE	4200*SE	ueno@es.l	nokudai.ac	
					.jp		
	クリーン	超高精度電子ビーム描画装	エリオニ	ELIONIX			
	クリーン ルーム内		クス				
	ルーム内	置	/ /			i	1
			//				
	ルーム内						
37	ルーム内	置					
37	ルーム内	置 Ultra-high precision	ELS-	ELS-	nano-		創成科学 研究棟
37	ルーム内	置 Ultra-high precision electron beam lithography		ELS- F125-U	support@e	es.hokudai	
37	ルーム内	置 Ultra-high precision	ELS-			es.hokudai	
37	ルーム内	置 Ultra-high precision electron beam lithography	ELS-		support@e	es.hokudai	創成科学研究棟

No	// Wee -	装	置	ne :	+n =-	4.0.4	装置設置	
	分類1 分類2	装置名	メーカー型名	Maker type	部屋メ・	内線 -ル	場所	
	クリーン	ドライ		туре	,			
	ルーム内	エッチン	アルバック	ULVAC			創成科学	
83	設置装置	グ装置					研究棟	
		Dry Etching	NLD-500	NLD-500	nano- support@	es.hokudai		
	クリーン	反応性イ			supporte	53.IIOKuuai		
	ルーム内	オンエッ	サムコ	SAMCO				
84	設置装置	チング装					創成科学	
		INDUCTI VELY	RIE-	RIE-	nano-	es.hokudai	研究棟	
		COUPLE	101iPH	101iPH	.ac.jp	es.hokudai		
	クリーン				.ac.jp			
	ルーム内	レーザー 描画装置	ネオアー ク	NEOARK				
	設置装置		_				創成科学	
85		Laser			nano-		研究棟	
		Direct Lithograp	DDB- 201-200	DDB- 201-200	support@	es.hokudai		
		hy	201 200	201 200	.ac.jp			
	クリーン	原子層堆						
	ルーム内	原丁層堆	Picosun	Picosun				
	設置装置	Descin						
86		Atomic					創成科学	
		Layer	SUNALE-	SUNALE-	nano-		研究棟	
		Depositio	R	R	.ac.jp	es.hokudai		
		n			.uc.jp			
	+==::	ソーラシ						
	専用測定装置	ミュレー	ワコム電創	WACOM				
87	衣但	タ					創成科学	
		SUPER	WXS-	WXS-	nano-		研究棟	
		SOLAR SIMULAT	156S- 1 2.AM1.5	156S- L2,AM1.5	.ac.jp	es.hokudai		
	r+ 0# 4n	イオン		,				
	成膜・加 工装置	ビームス	アルバック	ULVAC				
	上衣匠	パッタ装	/					
							A11 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
95		ion beam			nano-		創成科学 研究棟	
		lithograp	IBS-	IBS-		es.hokudai	WI JUIK	
		hy	6000S	6000S	.ac.jp			
		system						
		イオンミ				1		
	成膜・加	リング装	アルバッ	ULVAC				
	工装置	ガング表置	ク					
			2					
06			2				創成科学	
96				IRF-	nano-		創成科学研究棟	
96		置 lon milling	7 IBE- 6000S	IBE- 6000S	support@	es.hokudai		
96		置Ion	IBE-			es.hokudai		
96		置 lon milling	IBE-		support@	es.hokudai		
96		lon milling system	IBE-		support@	es.hokudai		
96	工装置	置 lon milling	IBE-	6000S Self-	support@	es.hokudai		
96	工装置	lon milling system 時間分解	IBE- 6000S	6000S	support@	es.hokudai		
96	工装置	置 lon milling system 時間分解 磁気光学 効果測定 time-	IBE- 6000S	6000S Self-	support@	es.hokudai	研究棟	
96	工装置	置 lon milling system 時間分解学 効果測定 time- resolved	IBE- 6000S	6000S Self-	support@	es.hokudai	研究棟工学部L	
	工装置	間 lon milling system B間分解 磁気光学 効果測定 time-resolved magneto-	IBE- 6000S	6000S Self-	support@.ac.jp	es.hokudai	研究棟	
	工装置	置 lon milling system 時間分解 磁気光学 効果測定 timesolved magneto- optical	IBE- 6000S	6000S Self-	support@.ac.jp		研究棟工学部L	
	工装置	間 lon milling system B間分解 磁気光学 効果測定 time-resolved magneto-	IBE- 6000S	6000S Self-	support@.ac.jp		研究棟工学部L	
	工装置 分光分析 装置	置 Ion milling system 時間分解 磁気果測定 time- resolved magneto- optical spectrosc opy system	IBE- 6000S	6000S Self-	support@.ac.jp		研究棟工学部L	
	工装置 分光分析 装置	間 lon milling system 時間分解 磁気光学定 time-resolved magneto-optical spectrosc opy system 高速レー	IBE- 6000S 自作	Self-made	support@.ac.jp murayama dai.ac.jp	a@ist.hoku	研究棟工学部L	
97	工装置 分光分析 装置 バイオ関 連分析装	置 lon milling system 時間分解 効果測定 time- respectrosc optical spectrosc opy system ボラッキーナ集	IBE- 6000S	6000S Self-	support@.ac.jp		研究棟 工学部L 棟	
	工装置 分光分析 装置	間 lon milling system 時間分解 磁気光学定 time-resolved magneto-optical spectrosc opy system 高速レー	IBE- 6000S 自作	Self-made	support@.ac.jp murayamadai.ac.jp	a@ist.hoku 9340	研究棟 工学部L 棟	
97	工装置 分光分析 装置 バイオ関 連分析装	置 lon milling system 時間分解学効果測 time- resolveto- optical spectrosc opy system 高速レーサ焦 点顕微鏡	IBE- 6000S 自作	Self-made	support@.ac.jp murayamadai.ac.jp 03-305 nic@es.hc	a@ist.hoku	研究棟 工学部L 東	
97	工装置 分光分析 装置 バイオ関 運分析装置	置 lon milling system 時間分解学 効果測 time- resolved magneto- optical spectrosc opy system 高速レー 歩点顕鏡 High	IBE- 6000S 自作 特型 ニコン	Self-made - Nikon	support@.ac.jp murayam: dai.ac.jp 03-305 nic@es.hc	a@ist.hoku 9340	研究棟 工学部L 東	
97	工装置 分光分析 装置 パイオ関連分析装置	間 lon milling system 時間分解 夢楽学 定 time-resolved magneto-optical spectrosc opy system 高速レーザー乗銭鏡 High Speed	IBE- 6000S 自作 キ型 ニコン	Self-made Nikon A1	support@.ac.jp murayamadai.ac.jp 03-305 nic@es.hc	a@ist.hoku 9340 kudai.ac.j	研究棟 工学部L 東	
97	工装置 分光分析 表置 バイオ分析 関装 バイオオ関装	置 lon milling system 時間分解学 効果測 time- resolved magneto- optical spectrosc opy system 高速レー 東通 原連 が に の が の は の は の に の が に の は の に に の に の に の に の に の に の に の に の に に の に の に に に に に に の に に に に に に に に に に に に に	IBE- 6000S 自作 特型 ニコン A1 ニコ本ロー	Self-made Nikon A1 Nikon,Nip	support@.ac.jp murayam: dai.ac.jp 03-305 nic@es.hc	a@ist.hoku 9340	研究棟 工学部L 東	
97	工装置 分光分析 装置 パイオ関連分析装置	間 lon milling system 時間分解	IBE- 6000S 自作 キ型 ニコン	Self-made Nikon A1	support@.ac.jp murayamadai.ac.jp 03-305 nic@es.hc	a@ist.hoku 9340 kudai.ac.j	研究棟 工学部L 東	
97	工装置 分光分析 表置 バイオ分析 関装 バイオオ関装	間 lon milling system 時間分解学定 time-resolved magneto-optical spectrosc opy system ボー振鏡 High Speed Laser 全反射鏡鏡	IBE- 6000S 自作 特型 ニコン A1 ニコ本ロー	Self-made Nikon A1 Nikon,Nip	support@.ac.jp murayamadai.ac.jp 03-305 nic@es.hc	a@ist.hoku 9340 kudai.ac.j	研究棟 工学部L 東	
97	工装置 分光分析 表置 バイオ分析 関装 バイオオ関装	置 lon milling system 時間分解学定 time- resolved magneto- optical spectrosc opy system ボー集鏡 High Speed Laser 全反射鐵鏡	IBE- 6000S 自作 特型 ニコン A1 ニロ本ロバー	Self-made Nikon A1 Nikon,Nip pon Roper	support@.ac.jp murayamadai.ac.jp 03-305 nic@es.hc	a@ist.hoku 9340 kudai.ac.j	研究棟 工棟 電研究所	
97	工装置 分光分析 表置 バイオ分析 関装 バイオオ関装	間 lon milling system 時間分解学定 time-resolved magneto-optical spectrosc opy system ボー振鏡 High Speed Laser 全反射鏡鏡	IBE- 6000S 自作 特型 ニコン A1 ニコ本ロー	Self-made Nikon A1 Nikon,Nip pon Roper	support@.ac.jp murayamadai.ac.jp 03-305 nic@es.hc	9340 9340	研究棟 工学部 上 電子 科 学 所 研究 所	
97	工装置 分光分析 表置 バイオ分析 関装 バイオオ関装	間 lon milling system 時間分解学定 time-resolved magneto-optical spectrosc opy system 高速 ナーザー規範 High Speed Laser 全反頻鏡 Total Internal	IBE- 6000S 自作 キ型 ニコン A1 ニコ本ー TE-	Self-made Nikon A1 Nikon,Nip pon Roper TE- 2000,EM-	support@.ac.jp murayamadai.ac.jp 03-305 nic@es.hc	9340 9340	工学部上電子科科等	
97	工装置 分光分析 表置 バイオ分析 関装 バイオオ関装	置 lon milling system 時間分解学定 time- resolved magneto- optical spectrosc opy system 高速ナー ザ原射 気果測 ・ を のすい のすい を のすい のすい を のすい のすい を のすい のすい を のすい のすい のすい のすい を のすい のすい のすい のすい のすい のすい のすい のすい	IBE- 6000S 自作 キ型 ニコン A1 ニロボー TE- 2000,EM-	Self-made Nikon A1 Nikon,Nip pon Roper	support@.ac.jp murayamadai.ac.jp 03-305 nic@es.hc p	9340 9340	研究棟 工模 電研究所 電子升科	

	電磁波分 析装置	高分解能X線回折装置	ブル カー・エ イエック	BRUKER AXS				
40	X線	Material research diffractometer		D8 Discover	nano- support@es.hokudai .ac.jp		創成科学 研究棟	
41	電磁波分析装置	超薄膜評価装置	日立	Hitachi			創成科学研究棟	
	分光	Ultra-thin Film Evaluation System	HD-2000	HD-2000	nano- support@e .ac.jp	es.hokudai		
42	成膜·加 工装置	集束イオンビーム加工観察 装置	日立	Hitachi	nano- support@es.hokudai .ac.jp		創成科学	
		Focused Ion Beam System	FB-2100	FB-2100			研究棟	
43	電磁波分析装置	レーザーゼータ電位計	大塚電子	Otsuka Electroni cs	04-304	9360	未指定	
	分光	Electrophretic Light Scattering Spectrophotometer	ELS-8000	ELS-8000	ijiro@poly. i.ac.jp	es.hokuda		
44	電磁波分 析装置	X線回折装置	リガク	Rigaku			創成科学 研究棟	
	X線	X-ray diffractometer	RINT- 2000/PC	RINT- 2000/PC	nano- support@es.hokudai .ac.jp			
45	電磁波分析装置	X線光電子分光装置	日本電子	JEOL			創成科学 研究棟	
	X線	X-Ray Photoelectron Spectrometer	JPS-9200	JPS-9200	nano- support@e .ac.jp	upport@es.hokudai		
	分光分析	FT-IR(フーリエ変換赤外線 吸収分光光度計)	日本分光	JASCO				
46		FT infrared absorption spectrophotometer (FT-IR)	FT/IR 660Plus	FT/IR 660Plus	nano- support@es.hokudai .ac.jp		創成科学 研究棟	
	表面分析·形態 観測用装 置	分子間力プローブ顕微鏡	Asylum Research	Asylum Research			A11 - 22-73 J.W.	
47		Atomic Force Microscope	MFP-3D (Molecul ar Force Probe 3D)	MFP-3D (Molecul ar Force Probe 3D)	nano- support@e .ac.jp	es.hokudai	創成科学 研究棟	
	表面分析·形態 観測用装置	走査型レーザ生物顕微鏡	オリンパス	Olympus	04-304	9360		
48	jan-	Laser scanning bio microscope	FV-300	FV-300	ijiro@poly. i.ac.jp	es.hokuda	創成科学 研究棟	
	分光分析	紫外可視近赤外分光光度計	パーキンエルマー	PERKIN ELMER				
49		Ultraviolet and visible near- infrared spectrophotometer		Lamda 900S	nano- support@e .ac.jp	es.hokudai	創成科学研究棟	

	バイオ関 連分析装 置	多色蛍光 タイムラ プス顕微	ニコン	Nikon	03-305	9340	電子科学	
106		Multi color and Time- lapse	Ti-E	Ti-E	nic@es.hokudai.ac.j p		研究所	
107	バイオ関 連分析装 置	リアルタイム共焦点顕微鏡	ニコン、横河電機	Nikon,Yo kogawa Electric Corporati on	03-305	9340	電子科学研究所	
		Real-time Confocal Microsco		Ti,CSU-	Ti,CSU-	nic@es.ho p	kudai.ac.j	
108	クリーン ルーム内 設置装置	電子線描画装置	エリオニクス	ELIONIX			工学部L	
	工学部棟 内	Electron beam lithograp	ERA- 8000FE	ERA- 8000FE	electronic .hokudai.a	s_tech@ist c.jp	棟	
109	クリーン ルーム内 設置装置	集束イオ ンピーム 加工装置	エリオニ クス	ELIONIX			工学部L	
	工学部棟 内	Focused ion beam system	EIP-3300	EIP-3300	sueoka@is ac.jp	st.hokudai.	棟	
114	画像分析 装置	多光子励 起共焦 レーザ査型 機能顕 ステ ム	オリンパ ス、スペ クトラ・ フィジッ クス	Olympus, Spectra- Physics			電子科学研究所	
		Multiphot on excitation	FV300- TP2- SK,MaiTa	FV300- TP2- SK,MaiTa	nic@es.ho p	kudai.ac.j		
115	バイオ関 連分析装 置	ABI PRISM 3100 DNA segencer	ライフテ クノロ ジーズ	Life Technolo gies			次世代物 質生命科 学研究セ	
		ABI PRISM 3100	ABI PRISM 3100	ABI PRISM 3100	akita@sci. c.jp	hokudai.a	ンター2期 棟	
	分解・蒸留・分 離・濃縮・抽出 装置	マイクロ 波試料前 処理装置	マイルス トーンゼ ネラル	Milestone General	02-321	9230		
117		High performa nce microwav e digestion system	ETHOS One	ETHOS One	tomokazu_yoshizaw a@cris.hokudai.ac.jp		創成科学 研究棟	
	環境試験 装置	環境試験 装置	Thermotr on	Thermotr on				
118		Environm ental Test Chamber s	ental Fest S-8-8200 S-8-8200 tota@eng.hol c.jp		hokudai.a	創成科学 研究棟		
	バイオ関 連分析装 置	細胞イン キュベー ター蛍光 顕微鏡 Cell	オリンパス	Olympus			創成科学	
128		incubator fluoresce nce microsco	LCV110	LCV110	mitomo@p udai.ac.jp	ooly.es.hok	研究棟	
	バイオ関連分析装置	熱レンズ顕微鏡システム	マイクロ化学技研	Institute of Microche mical Technolo gy			創成科学	
129		Thermal lens microsco pe	ITLM-10	ITLM-10	mitomo@p udai.ac.jp	ooly.es.hok	研究棟	

		1					
F0	バイオ関 連分析装 置	細胞調製システム	三洋電機 バイオメ ディカ	Sanyo Electric Biomedic al			
50		GMP compliant cell processing system	-	-	nano- support@es.hol .ac.jp	研究棟	
	クリーン ルーム内 設置装置	真空紫外光露光装置	エヌ工房	N- KOUBOU			
58		Vacuum ultraviolet photolithography (exposure) device	フォトク リエー ター PC-01-H	Photocre ator PC- 01-H	nano- support@es.hol .ac.jp	創成科学 研究棟 kudai	
59	クリーン ルーム内 設置装置	分子線エピタキシー装置	Riber	Riber		創成科学	
59		Molecular epitaxy system	32P	32P	hirotaka@cris.h ai.ac.jp	okud 研究棟	
	画像分析 装置	走査形プローブ顕微鏡	日本電子	JEOL		創成科学	
60		Scanning probe microscope	JSPM- 5200	JSPM- 5200	hara@sci.hokud	研究植	
	画像分析 装置	電界放射型走査型電子顕微 鏡	日本電子	JEOL			
61			Field emission scanning electron microscope	JSM- 6700FT	support@es hokuda		創成科学 研究棟 kudai
	画像分析 装置	走査型プローブ顕微鏡	日本電子	JEOL			
62		Scanning probe microscope	JSPM- 4210	JSPM- 4210	nano- support@es.hok .ac.jp	創成科学 研究棟 kudai	
63	画像分析装置	走査型電子顕微鏡	日立ハイ テクノロ ジーズ	Hitachi Hightech nologies		創成科学	
03		Scanning electron microscope	S-3500N	S-3500N	nano- support@es.hok .ac.jp	研究棟 kudai	
77	クリーン ルーム内 設置装置	超高精度電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELIONIX		創成科学	
11		Ultra-high precision electron beam lithography system 100kV	ELS- 7000HM	ELS- 7000HM	nano- support@es.hol .ac.jp	研究棟 kudai	
	電磁気分 析装置	磁気特性測定装置 MPMS	カンタ ム・デザ イン	Quntum Design			
81	伝導率測 定	Magnetic Property Measurement System	MPMS- XL50JS	MPMS- XL50JS	ktakahashi@es. dai.ac.jp	電子科学 研究所 hoku	
	電磁気分析装置	物理特性測定装置 PPMS	カンタ ム・デザ イン	Quntum Design			
82	伝導率測 定	Physical Property Measurement System	PPMS- 9LIS	erty PPMS- PPMS- ktakahashi@es.h		電子科学 研究所 hoku	

	,							
	クリーン ルーム内 設置装置	コンパク トスパッ タ装置	アルバック	ULVAC			創成科学	
131	創成棟内	Compact Sputter System	ACS- 4000-C3- HS	ACS- 4000-C3- HS	nano- support@es.hokudai .ac.jp		研究棟	
	クリーン ルーム内 設置装置	超高速ス キャン高 精度電子	エリオニクス	ELIONIX				
145		Ultra- high speed scanning electron beam	ELS- F130HM	ELS- F130HM	nano- support@e .ac.jp	es.hokudai	創成科学 研究棟	
146	クリーン ルーム内 設置装置	半導体薄 膜堆積装 置 Semicond	パスカル	Pascal	nano-		創成科学研究棟	
		uctor thin film layer	PAC- LMBE	PAC- LMBE	support@e .ac.jp	es.hokudai	マリノい木	
4:-	電磁波分 析装置	時間分解 光電子顕 微鏡シス	エルミ テック	Elmitec			創成科学	
147	分光	Time- resolved photoelec tron	PEEM-III	PEEM-III	nano- support@es.hokudai .ac.jp		研究棟	
	画像取得装置	収差補正 走査型透 過電子顕 微鏡	日本電子	JEOL				
148		Aberratio n corrected scanning transmiss ion	JEM- ARM200F	JEM- ARM200F	nano- support@e .ac.jp	es.hokudai	創成科学 研究棟	
	電磁波分 析装置	粉末X線 回折装置 Powder	リガク	Rigaku			電子科学	
149	X線	X-ray diffracto meter	RINT- UltimalII	RINT- UltimalII	ktakahashi@es.hoku dai.ac.jp			
179	専用測定装置	複合量子 ビーム超 高圧電子 顕微鏡	日本電子	JEOL			工学部新世代先端	
		Multi- beam Ultra- high	JEM- ARM1300	JEM- ARM1300		ng.hokuda	材料研究 実験棟	
180	専用測定 装置	レーザー 超高圧電 子顕微鏡	日立	Hitachi			工学部EM	
180	100	Pulsed- laser- equipped	H-1300	H-1300	denken@e i.ac.jp	ng.hokuda	棟	